

## 광 용발법에 의한 Type 304 스테인리스강 표면의 CsNO<sub>3</sub> 및 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 제거에 관한 연구

바이갈마, 원희준, 정종현, 문제권, 이근우  
한국원자력연구원, 대전광역시 유성구 대덕대로 1045  
[nhjwon@kaeri.re.kr](mailto:nhjwon@kaeri.re.kr)

### 1. 서론

방사성 시설 내부를 청정화하기 위해 오염 물질을 제거하는 제염공정을 적용 시킨다. 화학적 제염, 물리적 제염, 전기적 제염, 포말 제염, 초음파 제염 등 다양한 제염공정이 개발되어 사용 중에 있다. 최근에는 2차 방사성 폐기물의 발생량을 최소화 시키며 오염부위만을 선택적, 효과적으로 제거하는 전식제염 공정이 개발 중에 있다. 광 용발 제염공정의 특징은 제염 효과가 우수할 뿐만 아니라 2차 방사성 폐기물 발생량이 거의 없고 작업자의 방사선 위험도 없이 원격으로 적용할 수 있다는 것이다. 한국원자력연구원 내, 고준위 방사성 시설 내부의 청정화에 대비하여 광 용발 제염기술을 개발 중에 있다. 본 연구의 목적은 Cs<sup>+</sup> 이온 및 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 입자로 오염된 시편에 광용발 제염공정을 사용하였을 때 제염효과를 파악하는 것이다.

### 2. 실험 및 결과

실험에 사용된 광용발 제염 장치는 Q-switch Nd:YAG 레이저로서 광원의 파장은 532 nm, 밴드 폭 8 ns, 반복율 14 Hz, 에너지는 150 mJ/pulse이다. CsNO<sub>3</sub> 용액 및 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 함유한 용액을 사용하여 스테인리스강 시편을 오염시켰으며 이를 표면을 건조시킨 후 표면에 존재하는 원자들의 상태 물분율을 EPMA로 분석하였다. 레이저 조사 횟수, 적용 각도 및 광 에너지 밀도를 변화시켜가며 제염공정을 적용 시켰으며. 제염된 시편 표면을 다시 EPMA로 분석함에 의해 제염 후 잔존하는 오염물의 양을 측정하였다. 이로부터, 레이저 공정 인자의 변화에 따른 오염원 별 제염 효과를 평가하였다. 레이저 광에 의한 제염시편 표면의 변하는 SEM을 사용하여 관찰하였다. 제작된 Q-switched pulse type Nd:YAG laser 를 포함한 광용발 제염시스템을 그림 1에 나타내었다.

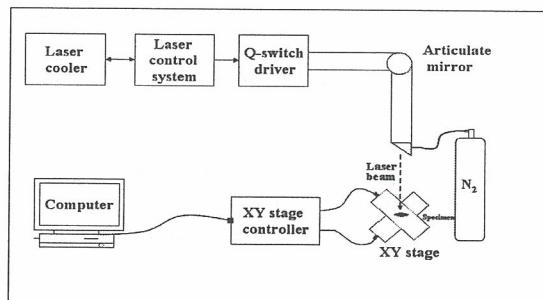


그림 1. 광용발 제염 실험 장치

제염 전 후 CsNO<sub>3</sub> 및 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>로 처리하였던 시편 표면의 원자 물 백분율을 표 1에 수록하였으며 CsNO<sub>3</sub> 및 Eu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>로 처리하였던 두 종류 시편 표면에 대한 제염 전, 후 전자현미경 사진을 각각 그림 2와 그림 3에 나타내었다.

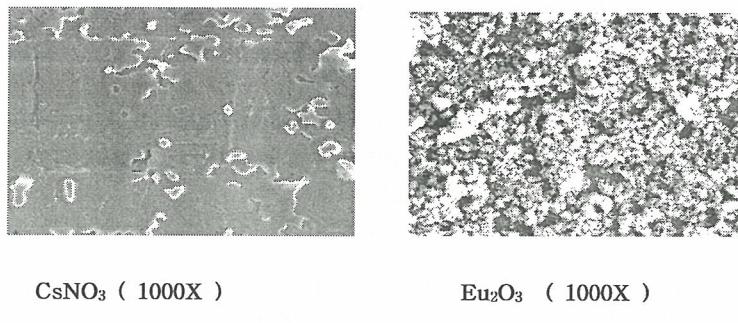
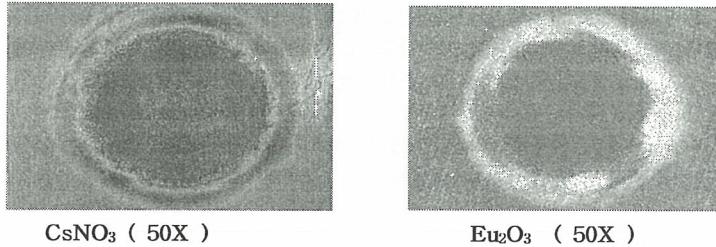
그림 2.  $\text{CsNO}_3$  및  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  용액으로 오염시킨 SUS 304 시편에 대한 제염 전 사진

표 1. 레이저 조사 전 후 SUS 304 시편 표면 원소의 상태 원자 몰 백분율

오염	원소 조건	O	Si	Cr	Fe	Ni	N	Cs	Eu
$\text{CsNO}_3$	제염 전	28.9	0.7	13.6	41.1	6.2	4.5	5.0	-
	제염 후	5.3	0.5	16.2	68.2	8.8	1.0	0.0	-
$\text{Eu}_2\text{O}_3$	제염 전	30.3	0.2	10.1	42.9	7.5	-	-	9.0
	제염 후	4.4	0.1	19.4	68.0	8.0	-	-	0.1

그림 3.  $\text{CsNO}_3$  및  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  용액으로 오염시킨 SUS 304 시편에 대한 제염 후 사진,  
(14 shots/sec, 6초,  $13.26 \text{ J/cm}^2$ )

실험에 사용된 시편 모두에 대해  $13.26 \text{ J/cm}^2$ 에서 에너지밀도에서 레이저 광을 84회 조사시킴에 의해 표면에 존재하는  $\text{Cs}^+$  및  $\text{Eu}^{3+}$  이온이 98 % 이상 제거되는 것으로 나타났다.  $\text{Eu}_2\text{O}_3$ 로 처리한 시편에 비해  $\text{CsNO}_3$ 로 처리한 시편에 대한 광 용발 제염공정 효율이 우세하였다.

### 3. 결론

제염 후 표면 관찰로부터,  $\text{CsNO}_3$  용액으로 오염시킨 시편 표면에서는  $\text{Cs}^+$  이온이 검출되지 않았으나  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  용액으로 오염시킨 시편 표면에는  $\text{Eu}^{3+}$  이온이 미량 잔존함을 확인하였다. 두 조건 모두 6초 이내에 시편 표면으로부터  $\text{Cs}^+$  및  $\text{Eu}^{3+}$  성분이 만족하게 제거되었다. 차후 방사능 오염시편에 대한 제염 연구와 이들에 대한 제염이론 규명 연구를 수행하고자 한다.

### 사사

본 연구는 교육과학기술부의 원자력 연구개발 중장기 계획 사업의 일환으로 수행되었습니다.